

第 143 回黒鉛化合物研究会プログラム

日 時： 令和 6 年 11 月 1 日（金）13:00～18:30
会 場： 大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス コンベンションホール
URL: <https://www.osakac.ac.jp/institution/campus/access/>
〒572-8530 大阪府寝屋川市初町 18-8
TEL : 072-824-1131
共 催： 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所

12:30～ 受付

13:00～13:05 開会の挨拶

13:05～14:05 「黒鉛層間化合物 ―残された課題―」

京都大学大学院 工学研究科

安部 武志 氏

14:20～15:20 「Na 触媒法によるドナー型黒鉛層間化合物の合成」

産業技術総合研究所 電子光基礎技術研究部門

伊豫 彰 氏

15:35～16:45 「層状構造を有する B/C/N 系材料の作製・物性および電池・光触媒への応用」

大阪電気通信大学 工学部

川口 雅之 氏

17:00～18:30 懇親会

参加費

学会会員、学生：無料、業界会員：3,000 円、学界協賛会員：2,000 円、業界協賛会員：7,000 円、学界非会員：3,000 円、業界非会員：10,000 円（当日徴収、現金のみ）

※今回の研究会は大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所と共催につき、そちらにご所属の方は参加費を無料とさせていただきます。

懇親会参加費 学界：5,000 円、業界：6,000 円、学生：3,000 円（当日徴収、現金のみ）

※「学界」：官公庁所属者、「業界」：企業所属者

※ できるだけお釣りの要らないようご協力下さい。

出欠に関しては 10 月 25 日（金）正午までにメールにて事務局稲本（j.inamoto@eng.u-hyogo.ac.jp）までご連絡頂くよう宜しくお願いいたします。なお、会場の準備の都合がありますので、締切厳守でお願いいたします。